

Introduction



☆ Minimal dark photon model

- 新たな U(1) ゲージ対称性を導入。
- 新しい粒子は新ゲージ粒子(X^µ)だけ。

■ SM粒子は新しい U(1) の下で中性。

■ 新ゲージ粒子は kinetic mixing を通じ てSMの荷電レプトンと結合する。

KLOE

Orsay

U70

LHCb µµ

Secluded

 10^{-14}

10-4

10-

10-6

10-7

θε

■ X は荷電レプトンと lepton flavor **conserving** かつ **universal** な結合。



Xは荷電レプトンと lepton flavor conserving かつ non-universal な結合。
 tree では電子との相互作用はないが 1-loop で存在する。

☆ beam dump experiment

■ 長寿命な中性粒子を探索するのに適した実験。



☆研究の動機と目的

- これまでの beam dump 実験からの制限は lepton flavor conserving な相互作用しか考えていない。
- 拡張された模型では lepton flavor violating な相互作用も生じうるのでは?(後述)。
- その場合 beam dump の制限はどうなるのか?
- $\mu \rightarrow e\gamma$ や $\mu \rightarrow eee$ の制限以下に新たな 制限を(間接的に)設けられるのでは?



- 2つの簡単なラグランジアンを考え、E137 electron beam dump実験の制限を導く。
- 注目するパラメータ領域は、<u>O(MeV-GeV)</u>、<u>O(10⁻⁸ 10⁻⁴)</u>。
 (質量)
 (結合定数)

Outline

■ Introduction.

- cLFV in gauge sector.
- Interaction Lagrangian in this talk.
- Number of expected events.
- Results.
- Summary.

cLFV in gauge sector

 $= U(1)_{L_{\mu}-L_{\tau}} \text{ が破れていないと Majorana neutrino 質量行列は}$ $Q_{L_{\mu}-L_{\tau}}(\overline{v^{c}}v)_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{} M_{v} = \begin{pmatrix} \times & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \times \\ 0 & \times & 0 \end{pmatrix} \\ \text{K} = \frac{1}{2} \text{K} = \frac{$

■ しかしこのままだと現実的な neutrino mass と MNS 行列が出ない。 $m_2^{\nu} = m_3^{\nu}$ $\theta_{12} = \theta_{13} = 0$ $\theta_{23} = 45^{\circ}$

■ 対称性を自発的に破るスカラーを導入し、質量行列の非0成分を増やす必要がある。

つづき

■ ここでは荷電レプトンの質量行列に非対角項が出たとする。

■ 荷電レプトンの質量行列が非対角的になると mixing が生まれ、gauge sector に LFV な項(非対角成分)が現れる。

$$g' \overline{\ell_i} \gamma^{\rho} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \ell_j X_{\rho} \qquad g' \overline{\ell_{\alpha}} \gamma^{\rho} V_{\alpha i}^+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} V_{j\beta} \ell_{\beta} X_{\rho}$$

$$(Foot, et al, PRD50(1994)]$$

- このシナリオは lepton flavor non-universal な場合のみ可能。
- universal な場合でも loop で生じることが考えられる。

※ 1-loop induced diploe operator [Nomura, Okada, Uesaka, JHEP01(2021)]

Int. Lagrangian in this talk

■ このトークでは以下の2つの相互作用ラグラジアンを考える。

1. $U(1)_{L_{\mu}-L_{\tau}}$ type $\mathcal{L}_{int} = g' \overline{\ell_{\alpha}} \begin{pmatrix} s^{2} & sc & 0 \\ sc & c^{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \gamma^{\rho} \ell_{\beta} X_{\rho} \qquad (s = \sin \theta)$ $(\alpha, \beta = e, \mu, \tau)$ 2. dark photon type LFV $\begin{bmatrix} \mathcal{N} - \mathbf{x} - \mathbf{y} \\ \mathbf{\varepsilon}, \ \mathbf{\varepsilon}', M_X \end{bmatrix}$

■ ともに新粒子は X のみでパラメータは3つ。

Number of expected events

■ イベント数の計算は以下の式を用いる。

$$N = N_e \frac{N_{\text{avo}} X_0}{A} \sum_{\ell=e,\mu} \int_{m_X}^{E_0 - m_\ell} dE_X \int_{E_X + m_\ell}^{E_0} dE_e \int_0^{T_{\text{sh}}} dt \qquad \qquad L_X = \beta \gamma \frac{n}{\Gamma_{\text{total}}} c$$

$$\times \left[I_e(E_0, E_e, t) \frac{1}{E_e} \frac{d\sigma_{\text{brems}}}{dx} \right]_{x = \frac{E_X}{E_e}} e^{-L_{\text{sh}}(L_X)} (1 - e^{-L_{\text{dec}}(L_X)}) \right] \text{Br}(X \to e^+e^-)$$

Ł

■ 生成断面積は Weizäcker-Williams 近似を用いる。





■ E137 electron beam dump実験を考える。

	target	E_0	$N_{\rm el}$		$L_{\rm sh}$	$L_{\rm dec}$	Ν.	N
		$[{\rm GeV}]$	$\#_{\rm electrons}$	$\operatorname{Coulomb}$	[m]	[m]	Ivobs	1 v 95%up
KEK	$^{183.84}_{74}\mathrm{W}$	2.5	$1.69 imes 10^{17}$	$27 \mathrm{~mC}$	2.4	2.2	0	3
E141	$^{183.84}_{~74}\mathrm{W}$	9	2×10^{15}	$0.32 \mathrm{~mC}$	0.12	35	1126^{+1312}_{-1126}	3419
E137	$^{26.98}_{\ 13}\mathrm{Al}$	20	$1.87{ imes}10^{20}$	30 C	179	204	0	3
Orsay	$^{183.84}_{74}\mathrm{W}$	1.6	2×10^{16}	$3.2 \mathrm{mC}$	1	2	0	3
E774	$^{183.84}_{74}\mathrm{W}$	275	5.2×10^{9}	$0.83~\mathrm{nC}$	0.3	2	0^{+9}_{-0}	18

[Andreas, Ph.D. thesis (2013)]



[Batell, Essig, Surujon, PRL113 (2014)]

■ Electron energy > 3 GeV, $\theta < \tan^{-1}(\frac{1.5}{383})$ 。

■ 3イベント以上のパラメータ領域を 95% C.L. の exclusion region とする。

Results

$$rightarrow L_{\mu} - L_{\tau}$$
 type

$$\mathcal{L}_{int} = g' \,\overline{\ell_{\alpha}} \begin{pmatrix} s^2 & sc & 0\\ sc & c^2 & 0\\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \gamma^{\rho} \ell_{\beta} X_{\rho}$$

$$(s = \sin \theta)$$

■ mixingが増大 ⇒ *ēe* 成分が増大。

- 生成断面積もシグナル(X → ēe)も増大し制限領域が拡大する。
- θ > 0.4 rad くらいで未制限領域を exclude できるようになる。

 × しかも μ → 3e の制限より下!!



☆ dark photon type

$$\mathcal{L}_{int} = e \,\overline{\ell_{\alpha}} \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon' & 0\\ \varepsilon' & \varepsilon & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \gamma^{\rho} \ell_{\beta} X_{\rho}$$
$$(\alpha, \beta = e, \mu, \tau)$$

- LFVを大きくしても生成断面積は増えない($L_{\mu} L_{\tau}$ も同様)。
- LFVが大きくなると Br(X → ee)が減少してしまい、制限領域が狭くなってしまう。



☆ 生成断面積

■ $x = 1(E_{A'} = E_e)$ 、LFCとLFVの結合定数が等しい($g = 10^{-6}$ とする)として比較。



■ LFVの生成はあまり効かない。。。



■ ALPs



Summary

- 質量が小さく、SM粒子と弱く相互作用する中性粒子に対して、古くから electron beam dump 実験の制限が考えられてきた。
- dark photon model と $U(1)_{L_{\mu}-L_{\tau}}$ model に cLFV ($e\mu$) 相互作用を加え、 electron beam dump の制限にどのような寄与をもたらすか調べた。
- U(1)_{Lµ-L_τ} type の場合は cLFV の寄与が大きくなるにつれ制限領域が拡大し、未制限領域に新たな制限が設けることも可能。
- dark photon type の場合は LFV の寄与が大きくなると $\mu \rightarrow eX$ の制限 に埋もれてしまう。
- このトークでは eµ 成分しか考えなかったが、 eτ, μτ 成分を入れて基本 的な振る舞いは変わらないと思われる。生成数は増えないし tau decay の閾値まで制限が届かない。

backup slides







Production cross section

■ vectorial int.





 $M_X \cdot ({\rm GeV})$